

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】 第 6 部門第 1 区分
 【発行日】 平成 19 年 12 月 20 日 (2007.12.20)

【公開番号】 特開 2006-153475 (P2006-153475A)
 【公開日】 平成 18 年 6 月 15 日 (2006.6.15)
 【年通号数】 公開・登録公報 2006-023
 【出願番号】 特願 2004-340250 (P2004-340250)
 【国際特許分類】

G 2 1 K 4/00 (2006.01)
C 0 9 K 11/00 (2006.01)
C 0 9 K 11/08 (2006.01)
C 0 9 K 11/61 (2006.01)
C 0 9 K 11/85 (2006.01)
C 2 3 C 14/06 (2006.01)
G 0 1 T 1/00 (2006.01)

【F I】

G 2 1 K 4/00 N
 G 2 1 K 4/00 M
 C 0 9 K 11/00 B
 C 0 9 K 11/08 A
 C 0 9 K 11/08 G
 C 0 9 K 11/61 C P F
 C 0 9 K 11/85
 C 2 3 C 14/06 L
 G 0 1 T 1/00 B

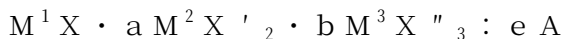
【手続補正書】
 【提出日】 平成 19 年 11 月 1 日 (2007.11.1)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】 特許請求の範囲
 【補正対象項目名】 全文
 【補正方法】 変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

支持体上に輝尽性蛍光体層を有する放射線画像変換パネルにおいて、少なくとも 1 層の該輝尽性蛍光体層が気相法（気相堆積法ともいう）により 50 μm～20 mm の膜厚を有するように形成され、該蛍光体層上にポリウレア保護膜が蒸着プロセスで形成されており、該蛍光体層上保護膜の屈折率が 1.2～2.0 であることを特徴とする放射線画像変換パネル。

【請求項 2】

前記輝尽性蛍光体が下記一般式（1）で表される化合物であることを特徴とする請求項 1 に記載の放射線画像変換パネル。

一般式（1）



〔式中、 M^1 は Li、Na、K、Rb 及び Cs から選ばれる少なくとも 1 種のアルカリ金属原子であり、 M^2 は M^1 以外の Li、Na、K、Rb 及び Cs から選ばれる少なくとも 1 種のアルカリ金属原子であり、 M^3 は Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb 及び Lu から選ばれる少なくとも一種の三

価金属原子であり、X、X' および X'' は F、Cl、Br 及び I から選ばれる少なくとも 1 種のハロゲン原子であり、A は、Eu、Tb、In、Cs、Ce、Tm、Dy、Pr、Ho、Nd、Yb、Er、Gd、Lu、Sm、Y、からなる群から選ばれる少なくとも 1 種の希土類元素であり、また、a、b、e はそれぞれ $0 \leq a < 0.5$ 、 $0 \leq b < 0.5$ 、 $0 < e \leq 0.2$ の範囲の数値を表す。]

【請求項 3】

前記保護膜の屈折率が 1.5～1.7 である保護膜が形成されており、該保護膜の厚さが 1～20 μm であることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の放射線画像変換パネル。

【請求項 4】

支持体上に輝尽性蛍光体層を有する放射線画像変換パネルの製造方法において、少なくとも 1 層の輝尽性蛍光体層が気相法により 50 μm ～20 mm の膜厚を有するように形成され、該蛍光体層上に屈折率が 1.2～2.0 である保護膜が蒸着プロセスで形成されており、更に、該保護膜を形成後、プレート加熱処理して保護膜表面をレベリング調整することを特徴とする放射線画像変換パネルの製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0016】

(請求項 1)

支持体上に輝尽性蛍光体層を有する放射線画像変換パネルにおいて、少なくとも 1 層の該輝尽性蛍光体層が気相法（気相堆積法ともいう）により 50 μm ～20 mm の膜厚を有するように形成され、該蛍光体層上にポリウレア保護膜が蒸着プロセスで形成されており、該蛍光体層上保護膜の屈折率が 1.2～2.0 であることを特徴とする放射線画像変換パネル。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0019】

(請求項 4)

支持体上に輝尽性蛍光体層を有する放射線画像変換パネルの製造方法において、少なくとも 1 層の輝尽性蛍光体層が気相法により 50 μm ～20 mm の膜厚を有するように形成され、該蛍光体層上に屈折率が 1.2～2.0 である保護膜が蒸着プロセスで形成されており、更に、該保護膜を形成後、プレート加熱処理して保護膜表面をレベリング調整することを特徴とする放射線画像変換パネルの製造方法。